

プラズマ・核融合学会誌

第81巻第9号

2005年9月

Rapid Communications

	Multi-Stage Ionization Dynamics of Carbon Film Irradiated by High Power Lasers 正木知宏, 岸本泰明	643
	Development of a Heat-Resistant Neutron Shielding Resin for the National Centralized Tokamak 森岡篤彦, 櫻井真治, 奥野功一, 玉井広史	645
	Development of a Gas Jet-Type Z-Pinch EUV Light Source for Next-Generation Lithography 宗 仁皓, MOHANTY R. Smruti, 渡辺正人, 河村 徹 沖野晃俊, 堀岡一彦, 堀田栄喜	647
	Observation of a Rotating Radiation Belt in LHD 増崎 貴, 坂本隆一, 宮沢順一, 田村直樹, PETERSON Byron J., LHD 実験グループ	649
小 特 集	プラズマプロセスによるカーボンナノチューブ配向成長の現状と課題 1. はじめに 畠山力三	651
	2. 磁場中 RF プラズマ CVD によるカーボンナノチューブ配向成長 畠山力三, 加藤俊顕	653
	3. 誘導結合 RF プラズマ CVD 法によるカーボンナノチューブ配向成長 本多信一, 尾浦憲治郎, 片山光浩	660
	4. 先端放電型マイクロ波プラズマ CVD による単層カーボンナノチューブ配向成長 岩崎孝之, 鍾 国倣, 大泊 巖, 川原田 洋	665
	5. RF プラズマ CVD によるカーボンナノウォールの配向成長 ... 平松美根男, 堀 勝	669
	6. カーボンナノチューブ配向成長への直流バイアスの効果 林 康明	674
	7. おわりに 林 康明	680
	コラム: カーボンナノチューブとプラズマプロセス 飯島澄男	682
	コラム: カーボンナノチューブによる電界放出ディスプレイ 齋藤弥八	683
講 座	微視的乱流シミュレーション 3. 微視的乱流の Vlasov シミュレーション 渡邊智彦	686
	4. 微視的乱流シミュレーションにおける将来に向けての課題 渡邊智彦, 洲鎌英雄, 井戸村泰宏	698
研 究 論 文	High-Z Dust Generation on Tungsten Surfaces due to Synergetic Erosion of Deuterium/Helium Plasma Exposures 西島 大, 天野浩嗣, 大野哲靖, 吉田直亮, 高村秀一	703
	JT-60U の加熱用中性粒子ビーム中の酸素量とプラズマ中の酸素量との関係 仲野友英, 小出芳彦, 本田 敦, 梅田尚孝, 秋野 昇, 東島 智, 竹永秀信, 久保博孝	708
レ ビ ュ ー 論 文	論文アブストラクトから原子分子の状態の情報を検出, 抽出する方法の研究 佐々木 明, 村田真樹, 金丸敏幸, 白土 保, 井佐原 均, 上島 豊, 山極 満	717
内 外 情 報	723
	【会議報告】異常吸収国際会議/International Symposium on Fusion Nuclear Technology (ISFNT)-7 【人事公募】	
Plasma & Fusion Calendar	727
本 会 記 事	729
	第22回年会日程表/第18回専門講習会開催のお知らせ	
新着文献リスト核融合科学研究所	737

表紙の絵

He プラズマ後照射後のタングステン表面のプリスターとプリスター表皮断面図。プリスターは 500 K, 3 時間の重水素プラズマ前照射によって形成され, その後, 2000 K, 1 時間の He プラズマによって照射されている。バルク層は高温の He プラズマ照射により再結晶化している(a)。プリスター表皮も再結晶化しており, サブミクロン大の He バブルが表皮に形成されている(b)。(p.703 研究論文「High-Z Dust Generation on Tungsten Surface due to Synergetic Erosion of Deuterium/Helium Plasma Exposures」西島 大 他)

【複写をされる方に】本誌に掲載された著作物を複写する場合は, 著作権者から複写権の委託を受けている次の団体から許諾を受けて下さい。

学術著作権協会

〒107-0052 東京都港区赤坂9-6-41 乃木坂ビル Tel 03-3475-5618 Fax 03-3475-5619

ただし, アメリカ合衆国における複写については, 下記へ。

Copyright Clearance Center, Inc. (CCC)

(222 Rosewood Drive, Danvers, MA 01923, USA Tel(978)750-8400; Fax(978)750-4744)